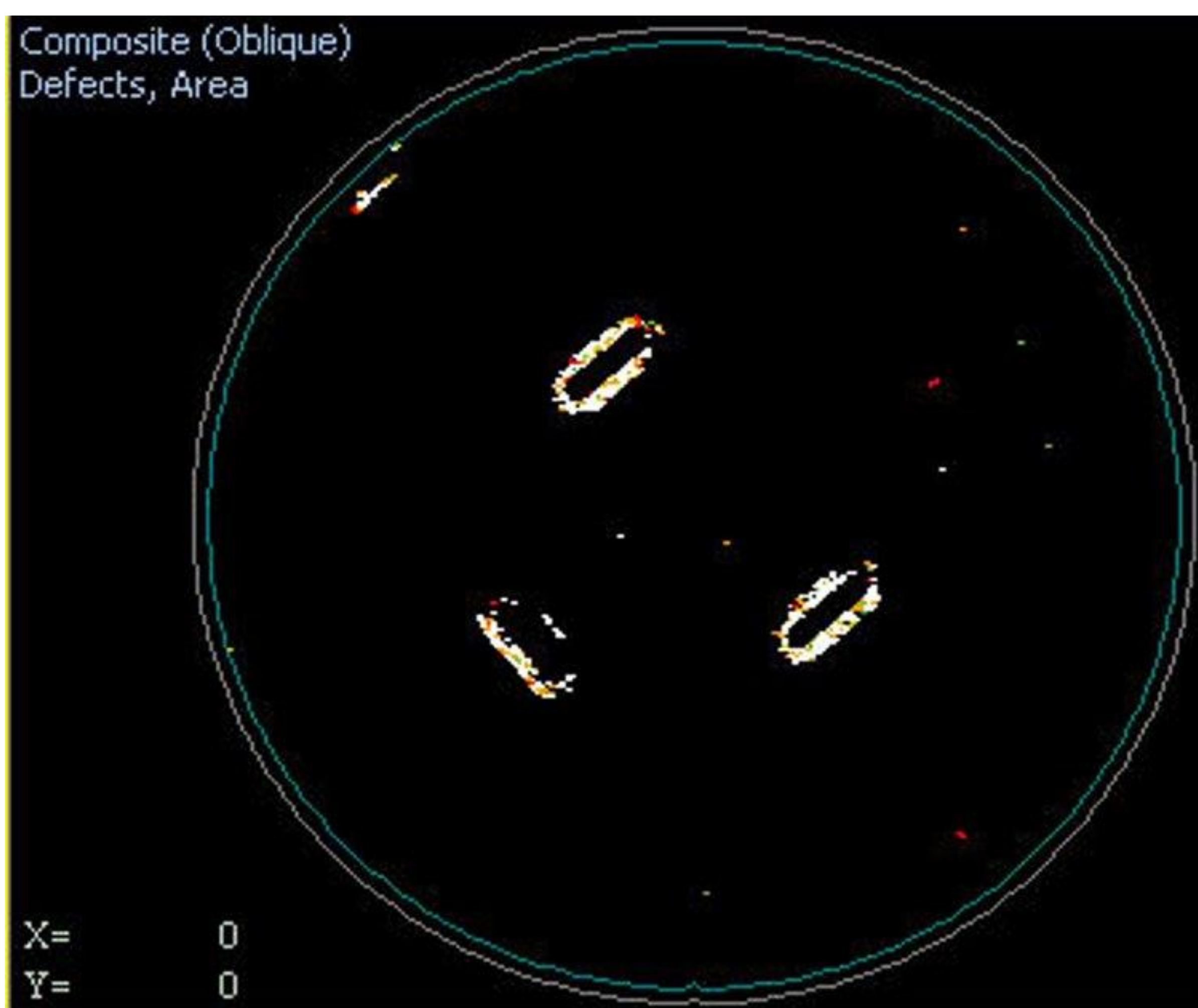


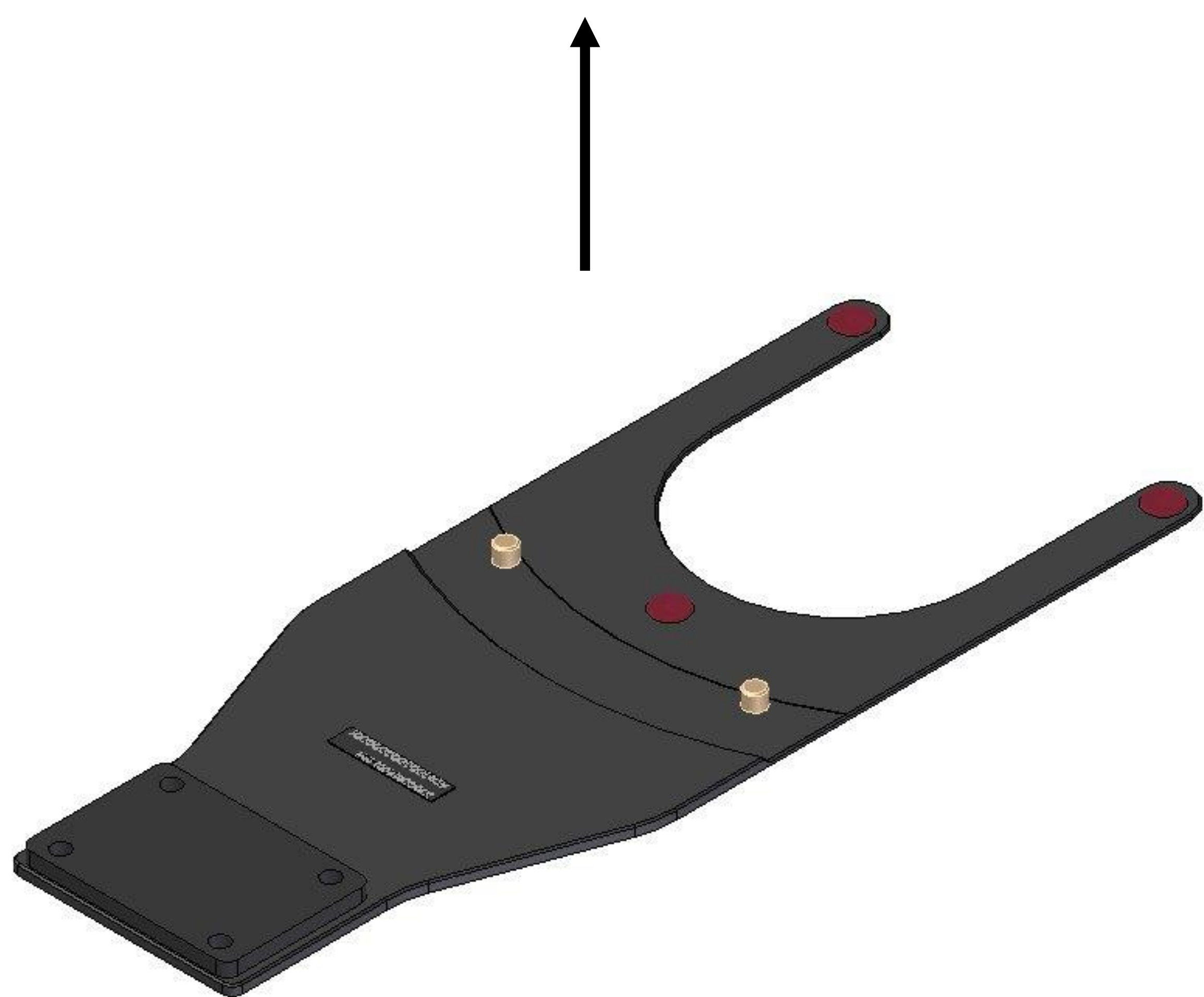
# ERFASSUNG UND OPTIMIERUNG VON FEHLERDICHTEN IN VOLLAUTOMATISCHEN FOTOLACKPROZESSIERUNGSANLAGEN

## Projektteam:

- Jannik Schuster
- Sebastian Marböck



Abdrücke eines Endeffektors auf einem Wafer



Beispielbild Endeffektor

## Projektbetreuer:

- Matthias Brunnbauer, M.Eng. – EV-Group
- Dominik Hager – EV-Group
- DI Dr. Silvia Huber – Andorf Technology School

## Aufgabenstellung:

- Partikeleintrag der vollautomatischen Fotolackprozessierungsanlagen erfassen
- Möglichkeiten ableiten, wie dieser Eintrag bestmöglich minimiert werden könnte

## Endergebnis:

- PGMEA Chemikalie als größter Partikelerzeuger
- Neue Testkomponenten (Chuck-/Endeffektor-Design) ohne signifikante Verbesserung
- Systematmosphäre nicht kontaminiert
- Abnehmende Partikelanzahl beim Handling mehrerer Wafer in Folge